

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

WEST

Generate Collection

Print

L5: Entry 2 of 4

File: DWPI

Jul 25, 1996

DERWENT-ACC-NO: 1996-334714
DERWENT-WEEK: 200148
COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Hard, amorphous, hydrogen-free carbon@ layers - are deposited by means of vacuum arc discharge process, and reduce friction between friction pair elements

INVENTOR: SCHEIBE, H; SCHULTRICH, B

PATENT-ASSIGNEE: FRAUNHOFER GES FOERDERUNG ANGEWANDTEN (FRAU)

PRIORITY-DATA: 1995DE-1002568 (January 27, 1995)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
DE 19502568 C1	July 25, 1996		003	C23C014/06
DE 59607242 G	August 16, 2001		000	C23C014/06
EP <u>724023</u> A1	July 31, 1996	G	006	C23C014/06
EP <u>724023</u> B1	July 11, 2001	G	000	C23C014/06

DESIGNATED-STATES: CH DE FR GB LI NL CH DE FR GB LI NL

CITED-DOCUMENTS:6.Jnl.Ref

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
DE 19502568C1	January 27, 1995	1995DE-1002568	
DE 59607242G	January 23, 1996	1996DE-0507242	
DE 59607242G	January 23, 1996	1996EP-0100905	
DE 59607242G		EP <u>724023</u>	Based on
EP 724023A1	January 23, 1996	1996EP-0100905	
EP 724023B1	January 23, 1996	1996EP-0100905	

INT-CL (IPC): C23 C 14/06; C23 C 14/24; C23 C 14/32; C23 C 30/00; F16 D 69/02

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 19502568C

BASIC-ABSTRACT:

The hard, thin, amorphous layer has a smooth, uniform surface morphology consisting of pure carbon without metal components and/or with less than 0.5 atom % hydrogen. The layer is deposited by means of a vacuum arc discharge process, in particular, with laser control.

The wear and corrosion resistant layer deposited at temperatures below 100deg.C has a modulus of elasticity higher than 400 GPa or a hardness than 40 GPa and it has a coefft. of friction less than 0.1 without lubrication, and less than 0.02 with a reduced lubricant supply.

The layer has a thickness of 300 nm. The layer is built up as a stack with alternating metal layers. The substrate material consists of high-speed cutting steels, aluminium, aluminium alloys, brass, bronze or plastics. The layer is optically transparent.

USE - For reduction of friction between friction pair elements, in motor-vehicle

industries, for example.

ADVANTAGE - High strength, very hard wear resistant layers can be produced at high coating rates.

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 724023B
EQUIVALENT-ABSTRACTS:

The hard, thin, amorphous layer has a smooth, uniform surface morphology consisting of pure carbon without metal components and/or with less than 0.5 atom % hydrogen. The layer is deposited by means of a vacuum arc discharge process, in particular, with laser control.

The wear and corrosion resistant layer deposited at temperatures below 100 deg. C has a modulus of elasticity higher than 400 GPa or a hardness than 40 GPa and it has a coefft. of friction less than 0.1 without lubrication, and less than 0.02 with a reduced lubricant supply.

The layer has a thickness of 300 nm. The layer is built up as a stack with alternating metal layers. The substrate material consists of high-speed cutting steels, aluminium, aluminium alloys, brass, bronze or plastics. The layer is optically transparent.

USE - For reduction of friction between friction pair elements, in motor-vehicle industries, for example.

ADVANTAGE - High strength, very hard wear resistant layers can be produced at high coating rates.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

DERWENT-CLASS: L02 M13 Q63
CPI-CODES: L02-H04; L02-J01E; M13-H04;

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 724 023 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
31.07.1996 Patentblatt 1996/31

(51) Int. Cl.⁶: **C23C 14/06, C23C 30/00,
C23C 14/32**

(21) Anmeldenummer: 96100905.7

(22) Anmeldetag: 23.01.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB LI NL

(30) Priorität: 27.01.1995 DE 19502568

(71) Anmelder: **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
80636 München (DE)**

(72) Erfinder:

- **Schelbe, Hans-Joachim Dr.
01277 Dresden (DE)**
- **Schultrich, Bernd, Dr.rer.nat.habil
D-01257 Dresden (DE)**

(54) **Harte, amorphe, wasserstofffreie C-Schichten**

(57) Die Erfindung betrifft harte, dünne, amorphe C-Schichten. Die harte, dünne, amorphe Kohlenstoffschicht besteht aus reinem Kohlenstoff ohne Komponenten eines Metalls und/oder Wasserstoff (< 0,5 at%) und ist mittels gepulster Lichtbogenentladung im Vakuum (Vakuumbogen), vorzugsweise lasergesteuerten, gepulsten Vakuumbogen (Laser-Arc), hergestellt. Die erfindungsgemäße Schicht hat einen Elastizitätsmodul > 400 G Pa bzw. eine Härte > 40 G Pa und sie kann Kohlenstoffteilchen enthalten, die überwiegend eine geringere Härte als die Schicht selbst besitzen. Die erfindungsgemäße Schicht besitzt ein ausgezeichnetes Reib-Gleit-Verhalten, welches durch einen Reibwert < 0,1 ohne Schmiermitteleinsatz bzw. durch einen Reibwert < 0,02 bei reduziertem Schmiermitteleinsatz gekennzeichnet ist, und zeigt eine hohe Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß sowie eine hohe chemische Beständigkeit.

EP 0 724 023 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine amorphe Kohlenstoffschicht, die sich durch einen Elastizitätsmodul (E-Modul oder Young's-Modul), der größer als 400 GPa ist, bzw. sich durch eine Härte, die größer als 40 GPa ist, auszeichnet, keinen Wasserstoff enthält und vorzugsweise zur Verringerung des Reibwertes bei Reibpaarungen unter reduziertem bzw. ohne Schmiermitteleinsatz eingesetzt werden kann.

Aus der DE 36 30 418 ist eine wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschicht, mit Zwischenschicht aus W, Cr, Ti, Si, Pa, Mo, bei Temperaturen 100°C-600°C, bevorzugt bei 300°C, bekannt und in der DE 41 27 639 werden Plasma CVD zur Herstellung von i-Carbon oder a-C:H-Schichten, die kein Metall enthalten, oder PVD-Verfahren, Sputtern oder Vakuumbogenverdampfung, wobei gleichzeitig Metalle verdampft und in die Schicht eingebaut werden, beschrieben, was eine partielle Carbidbildung zur Folge hat.

Diese im Stand der Technik beschriebenen Schichten weisen folgende Nachteile auf:

- relativ niedriger E-Modul in der Größenordnung der Nicht- oder Übergangsmetalle
- relativ niedrige Härte der amorphen Schichtmatrix
- härtere carbidische Einlagerungen wirken als abrasive Teilchen und können den Reibpartner verschleifen
- höhere Beschichtungstemperatur als 100°C, deshalb unökonomisch
- große Schichtdicke erforderlich, deshalb lange Beschichtungszeiten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine hochfeste, sehr harte Verschleißschuttschicht aus Kohlenstoff mit hoher Härte bzw. hohem E-Modul zu schaffen, die sich als Gleitschicht für Reibpaarungen unter reduzierten bzw. ohne Schmiermitteleinsatz verwenden läßt und dabei durch einen geringen Reibkoeffizienten eine hohe Abriebfestigkeit bei sich und den verwendeten Reibpartnern garantiert.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 gelöst.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß auf mindestens einer der Gleitflächen der Reibpaarung eine festhaftende, harte, amorphe, keinen Wasserstoff enthaltende Kohlenstoffschicht aus einem gepulsten, hochionisierten Kohlenstoffplasma im Vakuum abgeschieden wird, wobei dem Plasma keinerlei Wasserstoff oder Kohlenwasserstoff enthaltenden Komponenten zugeführt werden. Eine derartige Schicht ist gekennzeichnet durch einen Wasserstoffgehalt < 0,5 at.%, einen Elastizitätsmodul > 400 GPa, eine Härte > 40 GPa, eine Oberflächenrauheit im Bereich von ca. 100 nm. Sie kann Kohlenstoffteilchen enthalten, die überwiegend eine geringere Härte als die Schicht selbst besitzen. Dadurch werden einer derartigen Schicht selbstschmierende Eigenschaft verliehen. Die Dicke der

Schichten beträgt günstigerweise mindestens 100 nm bis maximal einige µm (vorzugsweise 300 nm). Bereits bei einer Dicke > 100 nm sind diese Schichten dicht geschlossen und garantieren die gleichen Eigenschaften und Standzeiten wie Schichten, die einige um dick sind. Gegenüber wasserstoffenthaltenden amorphen Kohlenstoffschichten bzw. aus Metall-Kohlenstoff bestehenden Schichten, die durch chemisch reaktive Plasmaprozesse abgeschieden werden, zeichnen sich diese Schichten durch einen höheren E-Modul bzw. Härte, eine höhere mechanische, thermische und chemische Stabilität aus und garantieren eine höhere Standzeit bei Gleitreibungsprozessen durch einen verringerten Reibkoeffizienten.

Eine amorphe wasserstofffreie Kohlenstoffschicht kann durch Ionenstrahlverfahren, durch gepulste Laserablation (Pulsed Laser Deposition / PLD) bzw. gepulste Bogenentladung im Vakuum aus einem graphitischen Target erzeugtem Ionen- bzw. Plasmastrahl abgeschieden werden, dem keinerlei wasserstoff- oder kohlenwasserstoffhaltige Komponenten zugeführt werden.

Von technischem Interesse sind dabei vor allem gepulste Bogenverfahren, da nur mit diesen technisch relevante Abscheideraten (> 200 nm/min) erzielbar sind. Vorzugsweise wird ein lasergesteuerter gepulster Vakuumbogen (LASER-ARC) verwendet. Beim Laser-arc wird mit einem Impulslaser der Bogen gezündet und gezielt über eine aus hochreinem Graphit bestehende, als Walze gestaltete, rotierende Kohlenstoffkathode (Target) geführt wird, was eine effektive und systematische Ausnutzung des Kathodenmaterials gewährleistet. Durch Verwendung von Stromimpulsen > 500 A und Variation der Bogenbrenndauer zwischen 10 und 100 µs kann sowohl die Materialmenge im Impuls, als auch die Struktur und somit die Eigenschaften der abgeschiedenen amorphen Schicht, bzw. die Erzeugung und der Einbau von Teilchen in die Schicht gezielt beeinflußt werden. Vorteilhaft ist, daß mit einer derartigen Quelle ein vollständig ionisiertes Plasma erzeugt wird und daß die Kohlenstoffionen überraschenderweise aus der Quelle (Kathoden-Anoden-Konfiguration) heraus eine ausreichende kinetische Energie erhalten, um die gewünschten Schichteigenschaften im Abscheideprozeß zu erzeugen. Dabei muß bei einfachster Anordnung keine zusätzliche Biasspannung an das Substrat angelegt werden.

Von entscheidender Bedeutung ist die Temperatur während des Abscheideprozesses. Extrem hohe E-Modul- bzw. Härtewerte werden erzielt, wenn die Temperatur am Substrat deutlich unterhalb von 100°C liegt und vorzugsweise die Raumtemperatur nicht übersteigt. Damit lassen sich derartige amorphe Kohlenstoffschichten besonders günstig auf temperaturempfindlichen Materialien, wie z.B. Schnellarbeitsstählen, Al-, Al-Legierungen, Messing, Bronze und insbesondere auf Kunststoffen aufbringen. Der LASER-ARC-Prozeß läßt sich problemlos durch Verwendung einer aus unterschiedlichsten Materialien, bzw. einer aus mehreren rotierenden Kathodenwalzen aus leitfähigen Materialien

(z.B. Metallen) aufgebauten Plasmaquelle so gestalten, daß Zwischenschichten beliebiger Dicke zur Formierung des Grenzgebietes (Interface) zwischen dem Bauteil und der amorphen Kohlenstoffschicht eingefügt werden können. Ebenso können Mehrfachschichtsysteme (Multilayer) abgeschieden werden, wobei eine Komponente stets aus amorphen, wasserstoffreiem Kohlenstoff besteht.

Durch Variation von Prozeßparametern (Beschichtungstemperatur, Bias-Spannung, Auftreffwinkel der C-Ionen auf dem Bauteil) kann z.B. ein Gradient der Härte bzw. des E-Moduls in der Schicht erzeugt werden. Dieser Gradient der Schicht bzw. Weichschicht ist dergestalt, daß die Härte bzw. das E-Modul von der Substrat- zur Außenseite zunimmt.

Die erfindungsgemäßen Schichten haben eine geringe Rauheit, die ≤ 100 nm ist, eine hohe thermische Stabilität bis zu Temperaturen von 600°C und eine hohe Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Chemikalien. Diese Schichten können Teilchen im Bereich von einigen 10 bis 100 nm Größe enthalten, die sich überwiegend durch eine geringere Härte als die Schicht selbst auszeichnen. Dadurch werden derartigen Schichten selbstschmierende Eigenschaften verliehen. Durch den hohen Elastizitätsmodul und die hohe Härte besitzen diese amorphen Schichten bereits bei einer Dicke von einigen 100 nm eine hohe mechanische Stabilität und können nur von solchen Materialien wie Diamant oder kubischem Bornitrid verletzt werden. Aufgrund der geringen Oberflächenrauheit werden bei dem als Gleitflächenmaterial eingesetzten Reibpartner keine Verschleißerscheinungen hervorgerufen, so daß eine Reibpaarung von höchster Stabilität erhalten wird.

Die erfindungsgemäßen Schichten werden in nachfolgenden Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Ausführungsbeispiel 1

Ein aus einer Al-Legierung bestehendes rotations-symmetrisches Bauteil mit einer Oberflächenrauheit $< 1,0 \mu\text{m}$ wird nach üblicher chemischer Vorreinigung und Trocknung in einer Vakuumkammer auf einem rotierenden Substrathalter montiert. Nach einem 10-minütigen Glimmprozeß unter Argon (Druck 6 Pa) bei dem die Beschleunigungsspannung so gewählt ist, daß die mittlere Substrattemperatur 100°C nicht überschreitet, wird mittels einer Kyropumpe ein Vakuum von 10^{-4} Pa erzeugt und mit dem lasergesteuerten gepulsten Vakuumbogen in 5 Minuten eine homogene 300 nm dicke amorphe Kohlenstoffschicht auf der zylindrischen äußeren Mantelfläche aufgebracht. Dabei wird am Substrat die Temperatur von 80°C nicht überschritten. Nach Ausbau des Bauteils aus der Kammer, wird zerstörungsfrei mittels Ultraschall-Oberflächenwellen-Messung ein E-Modul von 450 GPa geschlossen werden kann.

Dieses Bauteil wurde als Prüfkörper im Amsler-Reibtest eingesetzt, wobei ein reduzierter Schmiermitteleinsatz erfolgte. Als Gegenkörper wurde ein Graugußklotz mit einer Kraft von 200 N angepreßt und der

Reibwert, das Reibmoment und die Temperatur am Bauteil während des gesamten Versuchszyklus, ca. 5.000 km Laufleistung, gemessen. Nach kurzer Einlaufphase stellt sich ein Reibwert von 0.01 bei einer leicht erhöhten Temperatur von 24°C ein. Mittels AFM-Untersuchung konnten keinerlei Veränderungen an der Schichtoberfläche nach dem Verschleißtest nachgewiesen werden.

Ausführungsbeispiel 2

Ein aus einem Stahl bestehendes rotationssymmetrisches Bauteil mit einer Oberflächenrauheit $< 1,0 \mu\text{m}$ wird nach üblicher chemischer Vorreinigung und Trocknung in einer Vakuumkammer auf einem rotierenden Substrathalter montiert. Nach einem 10-minütigen Glimmprozeß unter Argon (Druck 6 Pa) bei dem die Beschleunigungsspannung so gewählt ist, daß die mittlere Substrattemperatur 100°C nicht überschreitet, wird mittels einer Kyropumpe ein Vakuum von 10^{-4} Pa erzeugt. Mit dem lasergesteuerten gepulsten Vakuumbogen, bei dem eine aus Graphit und Aluminium bestehende Kathodenwalze verwendet wird, wird zunächst eine ca. 20 nm dicke Al-Schicht und anschließend in 5 Minuten eine homogene 300 nm dicke amorphe Kohlenstoffschicht auf der zylindrischen äußeren Mantelfläche aufgebracht. Dabei wird am Substrat die Temperatur von 80°C nicht überschritten. Nach Ausbau des Bauteils aus der Kammer, wird zerstörungsfrei mittels Ultraschall-Oberflächenwellen-Messung ein E-Modul von 480 GPa bestimmt, wobei aus dieser Messung auf eine Schichthärte von ca. 40 GPa geschlossen werden kann. Dieses Bauteil wurde als Prüfkörper im Amsler-Reibtest eingesetzt, wobei ein reduzierter Schmiermitteleinsatz erfolgte. Als Gegenkörper wurde ein Graugußklotz mit einer Kraft von 200 N angepreßt und der Reibwert, das Reibmoment und die Temperatur am Bauteil während des gesamten Versuchszyklus, ca. 5.000 km Laufleistung, gemessen. Nach kurzer Einlaufphase stellt sich ein Reibwert von 0.01 bei einer leicht erhöhten Temperatur von 24°C ein. Mittels AFM-Untersuchung konnten keinerlei Veränderungen an der Schichtoberfläche nach dem Verschleißtest nachgewiesen werden.

Patentansprüche

1. Härte, dünne, amorphe Kohlenstoffschicht, die sich durch eine glatte, gleichmäßige Oberflächenmorphologie auszeichnet, bestehend aus reinem Kohlenstoff ohne Komponenten eines Metalls und/oder Wasserstoff ($< 0,5 \text{ at\%}$), die mittels gepulster Lichtbogenentladung im Vakuum (Vakuumbogen), vorzugsweise lasergesteuerten, gepulsten Vakuumbogen (Laser-Arc), hergestellt ist, dadurch gekennzeichnet, daß diese Schicht einen Elastizitätsmodul $> 400 \text{ GPa}$ bzw. eine Härte $> 40 \text{ GPa}$ aufweist, die Kohlenstoffteilchen mit einer überwiegend geringeren Härte als die Schicht enthalten

kann, die ein ausgezeichnetes Reib-Gleit-Verhalten besitzt, welches durch einen Reibwert $< 0,1$ ohne Schmiermitteleinsatz bzw. durch einen Reibwert $< 0,02$ bei reduziertem Schmiermitteleinsatz besitzt und eine hohe Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß und eine hohe chemische Beständigkeit zeigt.

2. Schicht nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß diese Schicht eine Dicke von mindestens 100 nm und maximal einigen wenigen μm aufweist. 10
3. Schicht nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß diese Schicht eine Dicke von 300 nm aufweist. 15
4. Schicht nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie im Wechsel mit einem Metall als Wechselschicht (Metall-Kohlenstoff-Multilayer) mit dem Laser-Arc abgeschieden ist. 20
5. Schicht nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie auch auf Substratmaterialien, die durch Temperatureinfluß ihre gezielt eingestellten Eigenschaften verlieren (z.B. Schnellarbeitsstähle, Al bzw. Al-Legierungen, Messing, Bronze, Kunststoffe u.a.) abgeschieden werden kann. 25
6. Schicht nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß diese Schicht bzw. Wechselschicht einen Gradient der Härte bzw. des E-Moduls enthält. 30
7. Schicht nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Härte bzw. das E-Modul der Schicht bzw. der Wechselschicht von der auf dem Substrat haftenden Seite zur Außenseite bzw. zur äußeren Deckschicht zunimmt. 35
8. Schicht nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß diese Schicht optisch transparent ist. 40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 10 0905

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	WEAR (1990), 141(1), 45-58 CODEN: WEARAH;ISSN: 0043-1648, 1990, XP000570574 HIRVONEN, J. P. ET AL: "Characterization and unlubricated sliding of ion-beam-deposited hydrogen - free diamond - like carbon films" * Seite 47, letzter Absatz - Seite 52, Absatz 1 *	1,2,5,8	C23C14/06 C23C30/00 C23C14/32
X	DIAMOND AND RELATED MATERIALS, Bd. 3, Nr. 11/12, 1.November 1994, Seiten 1319-1324, XP000483362 XIAO-MING HE ET AL: "STRUCTURAL CHARACTERIZATION AND PROPERTIES ENHANCEMENT OF DIAMOND-LIKE CARBON FILMS SYNTHESIZED UNDER LOW ENERGY NE+ BOMBARDMENT" *Absatz 3.1.3 bis Absatz 3.2.2*	1,5,8	
X	NUCL. INSTRUM. METHODS PHYS. RES., SECT. B (1993), B80-81(PT. 2), 1502-6 CODEN: NIMBEU;ISSN: 0168-583X, 1993, XP000568031 LEMPERT, G. D. ET AL: "Tribological evaluation of hydrogen - free ion beam deposited diamondlike carbon coatings" * Zusammenfassung; Tabelle 1 *	1,2,8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C23C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 14.Mai 1996	Prüfer Patterson, A
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 (01.92) (P.O.C.W.)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 96 10 0905

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	THIN FILMS, PROC. JT. 4TH INT. SYMP. TRENDS NEW APPL. THIN FILMS 11TH CONF. HIGH VAC., INTERFACES THIN FILMS (1993), 353-6. EDITOR(S): HECHT, G.; RICHTER, F.; HAHN, J. PUBLISHER: DGM INFORMATIONSGES., OBERURSEL, GERMANY. CODEN: 60DAAP, 1993, XP000570625 KOLITSCH, A. ET AL: "Modification of laser-arc DLC layers by ion beams" * Abbildungen 2,3 *	1	
A	THIN SOLID FILMS, Bd. 253, Nr. 1/02, 15.Dezember 1994, Seiten 125-129, XP000484036 SCHULTRICH B ET AL: "ELASTIC MODULUS OF DIAMOND-LIKE CARBON FILMS PREPARED BY PULSED VACUUM ARC" * Absatz 4; Abbildung 3 *	1	
A	THIN SOLID FILMS, Bd. 212, Nr. 1 / 02, 15.Mai 1992, Seiten 216-219, XP000360217 DAVANLOO F ET AL: "MECHANICAL AND ADHESION PROPERTIES OF AMORPHIC DIAMOND FILMS" * Abbildung 4 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 14.Mai 1996	Prüfer Patterson, A
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>* : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (01.92) (P04.00)